

公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会主催

第 29 回シンポジウム

「流動層の基礎と CVD/ALD による粉体材料の機能化」

主催 反応工学部会 CVD 反応分科会, CVD 研究会,
Cat-CVD 研究会, 反応工学部会触媒反応工学分科会, 粉体工学会

日時：2018 年 11 月 9 日(金) 13:00～17:45 終了後、懇親会を開催します。

会場：東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター 国際会議室

キャンパスマップ：<http://www.cictokyo.jp/access.html>

参加費：化学工学会 CVD 反応分科会法人賛助会員(無料), 化学工学会 CVD 反応分科会個人会員(2,000 円), 化学工学会反応工学部会会員(3,000 円), 化学工学会会員(4,000 円), CVD 研究会会員(4,000 円), Cat-CVD 研究会会員(4,000 円), 化学工学会触媒反応工学分科会会員(3,000 円), 粉体工学会会員(4,000 円), 非会員(10,000 円), 学生(無料)

申込方法：下記の Web サイトよりお申し込み下さい。

<https://goo.gl/7CtxvD>

上記サイトにアクセスできない場合には、(1)氏名、(2)所属、(3)連絡先 E-mail、(4)参加資格(所属学会等)、(5)懇親会出欠を明記の上、cvd@scej.org までメールにてお申し込み下さい。

申込締切：11 月 2 日(金) ただし、定員(100 名)になり次第締め切ります。

問い合わせ先：CVD 反応分科会事務局 E-mail：cvd@scej.org

開催趣旨

材料・デバイスの高機能化および微細化に伴い、大きな表面・界面を持つ粉体材料の重要性が増しています。例えばリチウムイオン電池においては、エネルギー密度の増大と安全性の担保という相反する要求に応え、また全固体電池のレート特性を改善するべく、活物質の微粒子表面を薄く均一に粉体コーティングする技術が求められています。そこで、粉体を低コストで大量に均一に処理する主要な技術である流動層の基礎から先端材料の合成および原子レベルでの均一な被膜形成まで、ドライプロセスによる粉体材料の機能化を学び反応機構を議論する研究会を開催します。

プログラム

12:30 受付開始

13:00～13:05 開会挨拶

13:05～14:05 (基調講演)「流動触媒層の特徴と工業プロセスへの応用」 鹿児島大学 甲斐 敬美 氏

14:05～14:45 「プラズマ CVD 法による DLC コーティング技術」

アドバンストマテリアルテクノロジー 本多 祐二 氏

14:45～15:25 「CVD の二次元場から三次元場への展開・流動層法による高純度・長尺カーボンナノチューブの高収率合成」 早稲田大学 野田 優 氏

15:25～15:40 休憩

15:40～16:20 「粉体への ALD コーティング概説・成膜方式と課題、アプリケーション、世界の動向」

ALD ジャパン 百瀬 渉 氏

16:20～17:00 「Particle ALD developments and opportunities」 Forge Nano Paul Lichty 氏

17:00～17:40 「室温原子層堆積法による微粒子上金属氧化物コーティング」

山形大学 廣瀬 文彦 氏

17:40～17:45 閉会挨拶

18:00～19:30 懇親会（懇親会会場 シンポジウム会場と同じ）

（参加費 一般：2,000 円，学生：1,000 円）

詳細は，以下の URL も参照下さい．

<http://www2.scej.org/cre/cvd/index.html>

シンポジウムオーガナイザー

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ 川上 雅人

広島大学 島田 学

ALD ジャパン 百瀬 渉

早稲田大学 野田 優

会場案内図：東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター 国際会議室



JR 田町駅芝浦口から右方向の階段をおりてすぐ
東京工業大学附属科学技術高等学校正門のとなり

JR 山手線・京浜東北線 田町駅から徒歩 1 分
都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅から徒歩 5 分